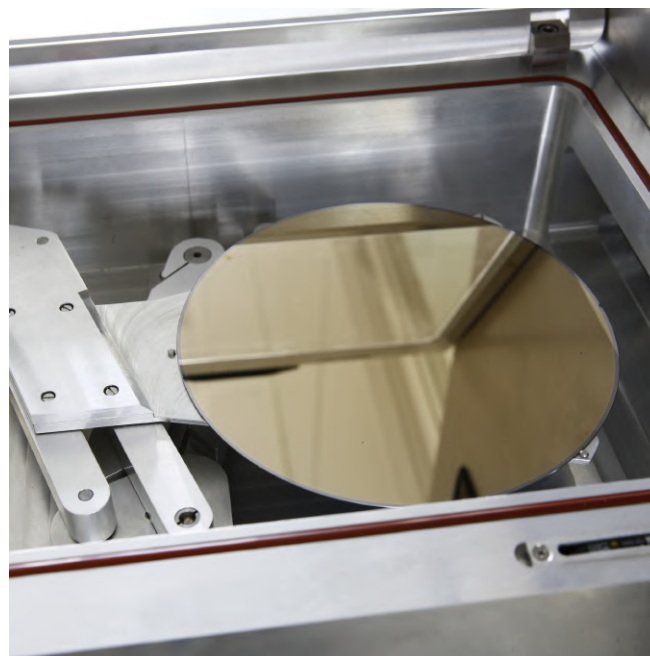


Плазма ТМ 200-01

Установка плазмохимического травления с источником индуктивно-связанной плазмы с возможностью травления во фтор- и/или хлорсодержащих средах



Технические характеристики:

Характеристика	Плазмохимическое травление кремния/поликремния/нитрида кремния	Реактивно-ионное травление металлизации
Скорость травления, нм/мин	1000 ÷ 1300	≥ 150
Максимальная мощность генератора ICP, Вт	до 2500	до 2500
Максимальная мощность генератора ВЧ стола, Вт	до 1500	до 1500
Рабочее давление, Па	1 ÷ 10	1 ÷ 10
Нагрев стенок реактора, °C	40 ÷ 60	40 ÷ 60
Мощность потребления, кВт	≤ 19	≤ 19
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика	

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин Ø 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Источник плазмы собственной разработки
- Встраивание в чистую комнату
- Безмасляная система откачки
- Габариты (ШхГхВ) не более 1900x2850x2000 мм

